

01;05.4

## Проникновение магнитного потока в сверхпроводник в режимах вихревая жидкость—вихревое стекло

© И.Б. Краснюк, Ю.В. Медведев

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины

Поступило в Редакцию 1 ноября 2004 г.

Рассматривается проникновение магнитного поля в полупространство для сверхпроводников второго рода, которые находятся в фазе вихревой жидкости или вихревого стекла. Предполагается, что магнитное поле резко увеличивается со временем на границе в режиме с обострением. Показано, что в каждой фазе возможна (эффективная) локализация магнитного потока в форме остановившейся магнитной волны на глубину  $x_s \propto e^{-\sigma} \sigma$  в режиме вихревой жидкости и  $x_s \propto (2\sigma)^{1/(\sigma+2)}$  — в режиме вихревого стекла, где параметр  $\sigma = U_0/T$  зависит от величины термоактивационного барьера  $U_0$  и температуры  $T$  в окрестности линии плавления  $T_m(B)$ , где  $B$  — индукция магнитного поля.

**Введение.** Известно, что даже при  $j < j_c$ , где  $j_c$  — плотность критического тока депиннинга, термически возбужденные вихревые нити могут преодолевать барьер пиннинга с помощью „прыжковой проводимости“: этот феномен называется крипом магнитного потока. Если при  $j \rightarrow 0$  существует бесконечный барьер пиннинга ( $\rho(j \rightarrow 0) \rightarrow 0$ ), то мы говорим о фазе вихревого стекла. Если барьер конечен ( $\rho(j \rightarrow 0) > 0$ ), то мы говорим о вихревой жидкости, где  $\rho$  — сопротивление потока [1].

В данной работе рассматривается стандартная задача о проникновении магнитного поля в полупространство  $x > 0$  в параллельной геометрии  $B \parallel z, E, j \parallel y$  и  $v \parallel x$ , где  $v = v_0 e^{-U(j)/T}$ ,  $U$  — активационный барьер, не зависящий от магнитного поля  $B$ ,  $T$  — температура,  $E$  — электрическое поле,  $v$  — скорость движения вихрей (которую в дальнейшем мы будем считать близкой к критической), а  $v_0$  — „микроскопическая“ скорость.

Граничное условие задается в режиме с обострением [2]

$$b(0, \tau) = b_0(1 - \tau)^m, \quad b(\infty, \tau) = 0, \quad (m < 0), \quad \tau > 0,$$

где  $b = B/H_{c1}$ ,  $H_{c1}$  — первое критическое поле,  $\tau = t/t_0$ ,  $t_0$  — время существования решения.

При  $m = 0$  в режиме вязкого течения потока такая задача рассматривалась в статье [3]; при  $m = 0$  в режиме крипа магнитного потока для моделей вихревой жидкости—вихревое стекло аналогичная задача рассматривалась в работе [1].

Данная статья состоит из двух частей: в первой части мы рассматриваем случай конечного активационного барьера и показываем, что задача сводится к диффузионному уравнению градиентного типа с коэффициентом диффузии, пропорциональным магнитному полю (уравнение (2)) — для системы в фазе вихревой жидкости; во второй части мы показываем, что в режиме вихревого стекла следует рассматривать уравнение со степенной нелинейностью по пространственной производной с показателем  $\sigma = U_0/T$ , где  $U_0 = U(j \rightarrow 0)$ . Такое уравнение (10) предложено в статье [1].

Для модели вихревой жидкости имеет место эффективная локализация магнитного потока с бесконечной скоростью распространения возмущений (рис. 1). Для модели вихревого стекла мы получаем магнитную волну с неподвижной точкой фронта, локализованную в области  $0 < x < x_0$  в течение всего времени действия граничного режима (рис. 2). Магнитные возмущения из области локализации не выходят, и однородной магнитный фон при  $x > x_0$  остается неизменным.

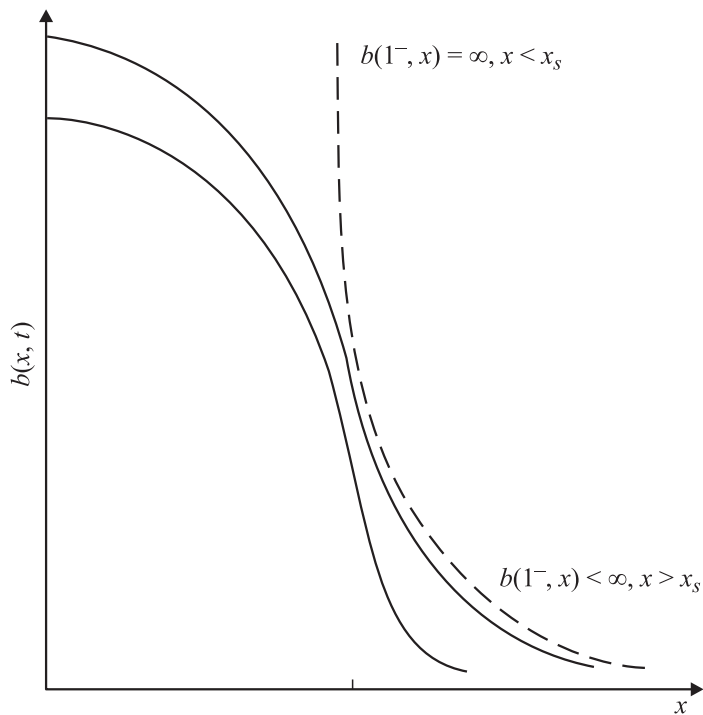
Режим вихревой жидкости отличается от режима вихревого стекла лишь тем, что практически вся энергия локализована в конечной области  $x < x_s$ . Отличие заключается в том, что магнитное поле правее точки  $x_s$  не равно нулю, но равномерно ограничено в течение всего процесса.

**1. Локализация магнитного потока в режиме вихревой жидкости.** Такое поведение магнитного поля следует ожидать при крипе для вихревой жидкости при высоких температурах  $T > T_m(B)$ , где  $T_m$  — линия плавления вихревой решетки ([1], с. 1347).

Различие между двумя фазами (вихревой жидкости и вихревого стекла) сверхпроводника определяется фундаментальным параметром

$$\alpha = \left| \frac{\partial U(j)}{\partial j} \right| \frac{\delta j}{T},$$

где  $\delta j$  есть характерный масштаб задачи. При  $\alpha \ll 1$  задача является линейной, а вихревая динамика — диффузионной; при  $\alpha \gg 1$  мы имеем дело с нелинейной краевой задачей в фазе вихревого стекла со степенным граничным режимом при  $m > 0$  и режимом с обострением — при  $m < 0$  [2] в указанном во введении граничном условии.



**Рис. 1.** Эффективная локализация магнитного потока. Практически вся энергия локализована в конечной области  $\{x < x_s(D, R_0)\}$ .

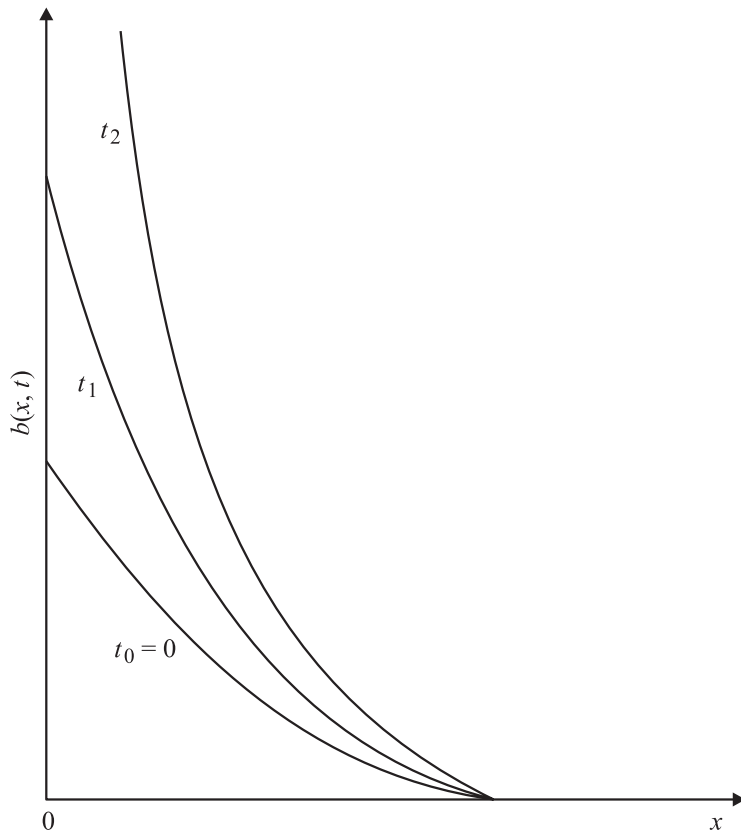
Для модели Андерсона–Кима с конечным активационным барьером имеет место соотношение

$$\alpha = \frac{U_0 j}{T j_c},$$

и отклик сверхпроводника всегда является квазилинейным (диффузионным) при малых плотностях тока  $j$ . Обратно, в режиме вихревого стекла отклик сверхпроводника на возмущения по току

$$\alpha = \mu \frac{U(j)}{T},$$

где  $\mu$  — некоторая постоянная, имеет степенную нелинейность типа  $|\nabla b|^\sigma$ , причем порядок уравнения повышается на единицу (уравнение (10)).



**Рис. 2.** Эволюция при  $t \rightarrow t_0^-$  локализованного режима с обострением для модели вихревого стекла ( $t_1 < t_2$ ).

Если имеют место равенства  $v_0 = Av_c$  и  $(\partial U / \partial j)|_0 = U_0 / j_c$ , где  $A$  — множитель порядка единицы,  $v_c$  — критическая скорость, то [1]

$$\rho = 2A\rho_{\text{flow}}(B) \frac{U_0}{T} e^{-U_0/T}, \quad (1)$$

где

$$\rho_{\text{flow}}(B) = \rho_n B / H_{c2}.$$

Здесь  $H_{c2}$  — второе критическое поле,  $\rho_n$  — сопротивление в нормальном состоянии.

Используя уравнение Максвелла

$$-\frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t} = \frac{\partial E}{\partial x}$$

и закон Ома  $E = \rho j$  с учетом соотношения (1), мы получаем уравнение

$$\frac{\partial B}{\partial t} = \frac{c^2}{4\pi} \nabla(\rho(B)\nabla B),$$

которое в безразмерном виде допускает представление

$$\frac{\partial b}{\partial \tau} = D \nabla(\rho(b)\nabla b), \quad (2)$$

где мы ввели следующие безразмерные координаты:  $x \rightarrow x/\lambda$ ,  $\tau = t/t_0$ , а коэффициент диффузии равен

$$D = \frac{H_{c1}}{H_{c2}} c^2 \rho_n \frac{t_0}{\lambda^2}.$$

Здесь  $\lambda$  — лондоновская глубина проникновения,  $c$  — скорость света, и в силу соотношения (1)  $\rho(b) = 2\sigma e^{-\sigma b}$ .

Рассмотрим для уравнения (2) следующее граничное условие:

$$b(0, \tau) = b_0(1 - \tau)^{-1}, \quad \tau < 1, \quad b_0 = \text{const} > 0. \quad (3)$$

Краевая задача (2)–(3) имеет решение в разделяющихся переменных [2]

$$b_s(x, \tau) = b_0(1 - \tau)^{-1}(1 - x/x_s)^2, \quad 0 < x \leq x_s, \quad (4)$$

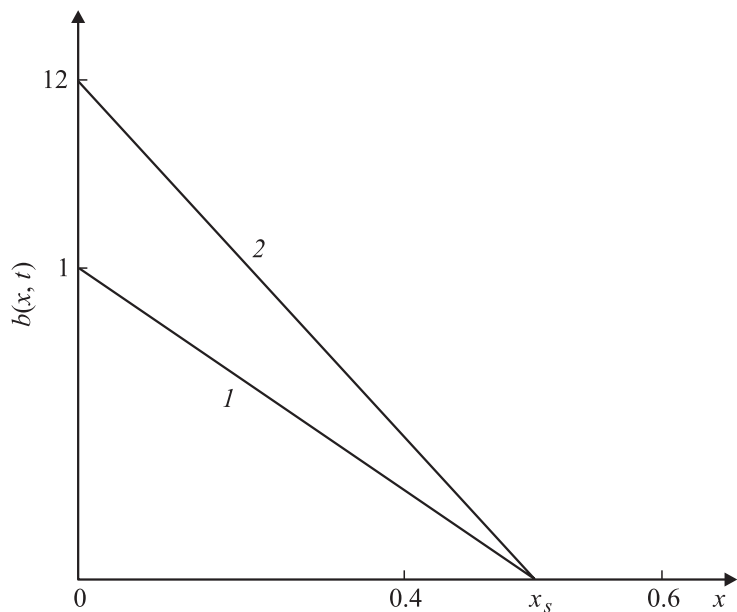
где

$$x_s = (6Db_0)^{1/2} \quad (D \propto \sigma). \quad (5)$$

При  $x > x_s$  эта функция равна нулю (рис. 3). Из представления решения (4)–(5) следует, что распространение магнитного поля локализовано, несмотря на неограниченное нарастание поля в этой области при  $\tau \rightarrow 1^-$ .

В [1] рассматривалось уравнение (2) при постоянном коэффициенте диффузии (в окрестности точки  $b \gg 1$ ). В этом случае оно имеет простой вид

$$\frac{\partial b}{\partial \tau} = D\Delta b. \quad (6)$$



**Рис. 3.** Остановившаяся магнитная волна. Параметры:  $D = 0.354$ ,  $\sigma = 2$ ,  $b_0 = 1$ ,  $x_s = 0.5$ ; 1 —  $t_0 - t = 1.25 \cdot 10^{-2}$ ; 2 —  $t_0 - t = 9 \cdot 10^{-4}$ .

Рассмотрим для определенности граничное условие

$$b(0, \tau) = b_0 \exp R_0(1 - \tau)^{-1}, \quad R_0 = \text{const} > 0 \quad (7)$$

и начальное условие

$$b_0(x) = \text{const}. \quad (8)$$

Мы выбрали граничное условие (7) в экспоненциальной форме лишь по той причине, что в этом случае решение представимо в аналитической форме (см. [2]). Связано это также с тем, что коэффициент диффузии является постоянным. Для общего уравнения (2) могут быть построены автомодельные решения в полупространстве  $\{x > 0\}$  с заданным при  $x = 0$  граничным режимом вида

$$b(0, \tau) = b_1(\tau), \quad \tau > 0,$$

где  $b_1(\tau)$  неограниченно возрастает при увеличении  $\tau$ .

Например, если  $b_1(\tau) = b_0(1 + \tau)^m$ ,  $m > 0$ , то соответствующее решение имеет вид

$$b_A(x, \tau) = b_0(1 + \tau)^m f_A(\xi), \quad \xi = x / (1 + \tau)^{(1+m\sigma)/(\sigma+2)}.$$

Если же  $b_1(\tau) = b_0 e^\tau$ , то

$$b_A(x, \tau) = b_0 e^\tau f_A(\xi), \quad \xi = x / \exp\left\{\frac{\sigma}{\sigma+2} \tau\right\}.$$

Эти автомодельные решения являются асимптотически устойчивыми.

Начально-краевая задача (6)–(8) имеет аналитическое решение ([2], с. 132), график которого изображен на рис. 1. Как и на рис. 2, практически вся энергия локализована в конечной области  $x < x_s$ , где  $x_s = 2(DR_0)^{1/2}$ . Для любого  $x_1 > x_s$  энергия

$$W(x_1, t) = \int_{x_1}^{\infty} b(\xi, t) d\xi < \text{const}, \quad t \in (0, t_0).$$

Отметим независимость эффективной глубины локализации от амплитуды  $b_0$  (в случае учета зависимости  $\rho(b)$  это не так).

Таким образом, в области полей, отличных от  $H_{c_2}(T)$ , где сверхпроводник находится в фазе вихревой жидкости, имеет место строгая локализация магнитного поля (по терминологии [2]). В окрестности  $H_{c_2}(T)$  имеет место только эффективная локализация. Объясняется это тем, что, когда линия плавления  $B_m(T)$  приближается к линии  $H_{c_2}(T)$ , имеет место кроссовер, где параметр порядка резко увеличивается и становятся важными флуктуации вблизи  $H_{c_2}(T)$  (см. соответствующую диаграмму для фазы вихревой жидкости на рис. 2 из [1]).

**2. Модель вихревого стекла.** В режиме вихревого стекла в области температур  $T$ , близких к линии плавления  $T_m(B)$ , отклик системы становится сильно нелинейным, поскольку параметр  $\alpha \rightarrow \infty$  при  $j \rightarrow 0$ . Уравнение (2) при этом следует заменить на уравнение [1]

$$\frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} [vB]. \quad (9)$$

В ([1], с. 1351) показано, что если выбрать активационный барьер в виде

$$U(j) = U_0 \ln\left(\frac{j_c}{j}\right),$$

а скорость движения вихрей в виде

$$v = v_0 \exp[-U(j)/T] = v_0 J |J|^\sigma \quad (J = j/j_c),$$

в окрестности некоторого равновесного значения  $B = B_0$  (в нашем случае  $B = B_{c1}$ ), то уравнение непрерывности вихревой линии (9) допускает редукцию к уравнению

$$\frac{\partial b}{\partial t} = \nabla(\nabla b |\nabla b|^\sigma), \quad (10)$$

где  $\sigma = U_0/T$ , а безразмерные координаты суть  $x \rightarrow x/d_p$ ,  $t \rightarrow tv_0/d_p$ ,  $d_p = cB_0/4\pi j_c$ , а  $j_c$  — критический ток. (При  $d_p/v_0 = t_0$  мы получаем предыдущее соответствие  $t \rightarrow \tau$ ).

Выражение для скорости мотивировано требованием получить при высоких температурах  $\sigma \rightarrow 0$  кроссовер к режиму вязкого движения вихрей  $v \propto J$ . Таким образом, уравнение (10) описывает лишь возмущения магнитного поля на фоне равновесного значения  $B_0$ . Однако в рамках теории слабого коллективного пиннинга такая модель согласуется с экспериментальными данными (см., например, [4,5]).

Как показано в ([1], рис. 6), вблизи линии плавления  $B_m(T)$  термоактивационный (конечный) барьер, препятствующий движению вихрей, является достаточно большим,  $T \ll U_0 < \infty$ , и вихревая жидкость запиннингована (ТАФФ-режим). Вблизи верхнего критического поля  $H_{c2}(T)$  барьер является малым,  $U_0 \ll T$ , и вихревая жидкость не может быть запиннингована (FF-режим). Ниже мы показываем, что параметр  $\sigma = U_0/T$  определяет глубину проникновения магнитного потока в полупространство в режиме с обострением. Случай  $\sigma \gg 1$  для конечного образца исследован в [1].

Уравнение (10) описывает процессы с конечной скоростью распространения возмущений по любому постоянному фону магнитного поля. Так, функция  $b(x, t) = b_A(x, t)$  является решением, которое имеет конечный фронт на однородном (нулевом) фоне.

Рассмотрим уравнение (10) с граничным условием

$$b(0, t) = b_0(1 - t)^m, \quad 0 < t < 1, \quad m < 0.$$

Соответствующее автомодельное решение имеет вид

$$b_A(x, t) = b_0(1 - t)^m \theta_A(\xi), \quad (11)$$



где

$$\xi = \frac{x}{(1-t)^{(1+m\sigma)/(\sigma+2)}}.$$

Здесь функция  $\theta_A \geq 0$  — обобщенное решение краевой задачи

$$b_0^\sigma (|\theta'_A|^\sigma \theta'_A)' - \frac{1+m\sigma}{\sigma+2} \theta'_A \xi + m\theta_A = 0, \quad \xi > 0 \quad (12)$$

с граничным условием

$$\theta_A(0) = 1, \quad \theta_A(\infty) = 0.$$

В частном случае  $m = -1/\sigma$  уравнение (12) легко интегрируется. Соответствующее автомодельное решение

$$b_A(x, t) = b_0(1-t)^{-1/\sigma} [(1-x/x_0)_+]^{(\sigma+2)/\sigma},$$

где

$$x_0 = \frac{\sigma+2}{\sigma} \left[ \frac{2\sigma(\sigma+1)}{(\sigma+2)} \right]^{1/(\sigma+2)} b_0^{\sigma/(\sigma+2)}, \quad (13)$$

представляет собой магнитную волну с неподвижной точкой фронта, локализованную в области  $0 < x < x_0$  в течение всего времени действия граничного режима с обострением. Магнитные возмущения из области локализации не выходят, и однородный магнитный фон при  $x > x_0$  остается неизменным (рис. 3). Здесь введено обозначение  $(\kappa)_+ = \{\kappa \text{ при } \kappa \geq 0; 0 \text{ при } \kappa < 0\}$  и под  $1^-$  мы понимаем точный верхний предел слева.

Пространственно-временная структура автомодельного решения (11) указывает на то, что при  $m < -1/\sigma$  действие режима с обострением не будет локализовано [2], т.е.

$$x_f(t) \sim (1-t)^{(1+m\sigma)/(\sigma+2)} \rightarrow \infty$$

при  $t \rightarrow 1^-$ , где  $x_f$  — координата фронта волны.

Отметим, что в случае степенного граничного режима ( $m > 0$ ) можно получить аналогичный результат, который при  $m = 0$  вырождается в формулу для координаты фронта в пластине  $b(x_f, t) = 0$  вида

$$x_f(t) = (1+t)^{1/\sigma}, \quad \sigma \gg 1,$$

(см. [1]). Аналогичная формула для полупространства, рассчитанная по методике [2], имеет вид

$$\bar{x}_f = (1+t)^{1/(\sigma+2)}, \quad t \rightarrow t/t_0, \quad \sigma > 0.$$

При  $m \in (-1/\sigma, 0)$  есть локализация магнитного потока, причем поле растет до бесконечности только в точке  $x = 0$  ([2], с. 92).

Для фазы вихревого стекла в режиме с обострением магнитный поток проникает в полупространство на конечную глубину, которая зависит от температуры и термоактивационного барьера через параметр  $\sigma$  по формуле (13).

Аналогичную формулу для режима вихревой жидкости можно записать в виде

$$x_s = [2Db_0e^{-\sigma}\sigma]^{1/2}. \quad (14)$$

Как видим, когда барьер активации мал ( $\sigma \rightarrow 0$ ), магнитное поле почти не проникает в сверхпроводник.

Для модели вихревого стекла при любых конечных температурах следует определить предел в соотношении (13) при  $\sigma \rightarrow \infty$ , что приводит к равенству

$$x_0 = [2\sigma]^{1/(\sigma+2)} + O(\sigma^{-1}). \quad (15)$$

Из соотношений (14)–(15) вытекают следующие утверждения: 1а) при  $\sigma \rightarrow \infty$  для модели вихревой жидкости глубина проникновения магнитного потока  $x_s(\sigma) \rightarrow 0$ ; 2а) для модели вихревого стекла глубина проникновения магнитного поля при  $\sigma \rightarrow \infty$  стремится к единице.

С другой стороны: 1б) при  $\sigma \rightarrow 0$  в режиме вихревой жидкости мы имеем асимптотическую формулу  $x_s = [2Db_0\sigma]^{1/2}$ ; 2б) при  $\sigma \rightarrow 0$  в режиме вихревого стекла имеет место асимптотика  $x_s = 2\sigma^{1/2}$ . Для идентичных краевых условий следует положить  $D = b_0 = 1$ . Тогда указанные выше формулы совпадают с точностью до множителя  $\sqrt{2}$ , что имеет простой физический смысл.

Таким образом, отличие отклика сверхпроводника на внешнее (граничное) возмущение при слабых возмущениях по току  $j_c - j \ll j_c$  [1] в каждой из рассмотренных фаз имеет место лишь при достаточно больших  $\sigma > 0$ .

## Список литературы

- [1] *Blatter G., Feigelman M.V., Geshkenbein V.B.* et al. // *Rev. of Modern Phys.* 1994. V. 66. N 4. P. 1125–1388.
- [2] *Самарский А.А., Галактионов В.А., Курдюмов С.П., Михайлов А.П.* Режимы с обострением для квазилинейных параболических уравнений. М.: Наука, 1987. 480 с.
- [3] *Романовский В.Р.* // *ЖТФ.* 2000. Т. 70. В. 12. С. 47–57.
- [4] *Kung P.G., Maley M.P., McHenry M.E.* et al. // *Phys Rev. B.* 1992. V. 48. N 18. P. 13922–13938.
- [5] *Zeldov E., Amer N.M., Koren G.* et al. // *Phys. Rev. Lett.* 1989. V. 62. P. 3093–3098.